

# GMM – Fachgruppe 1.2.3 Abscheide- und Ätzverfahren

## Nutzergruppentreffen PVD&PECVD, Ätzen –Vortragsübersicht (1)

1. Konditionierungseffekte bei Metal DPS Anlagen  
*Thomas Zwack, Texas Instruments Deutschland GmbH*
2. Erhöhung des Wirkungsgrades der VOR Matchbox an IMP Vectra  
*Robert Fischer, Texas Instruments Deutschland GmbH*
3. Degeneration von Remote-Plasmaquellen  
*Jürgen Axthaler, Texas Instruments Deutschland GmbH*
4. Bosch-Prozess - wie regelt die Kammer?  
*René Puschmann, Fraunhofer IZM-ASSID*
5. Oxide etch vs. Polymer deposition at the bottom of deep TSV-structures  
*Christian Kuhnt, X-FAB MEMS Foundry GmbH*
6. In vacuo Plasmaclean Anwendungen in einer Barrier/Seed-Klusteranlage für Metallisierungen  
*Lukas Gerlich, Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems IPMS-Center Nanoelectronic Technologies (CNT)*

# GMM – Fachgruppe 1.2.3 Abscheide- und Ätzverfahren

## Nutzergruppentreffen PVD&PECVD, Ätzen –Vortragsübersicht (2)

### 7. Diverse Themen

*Franz Nilius, TDK-Micronas GmbH*

### 8. Probleme bei HDP Prozessen zur SiO<sub>2</sub> Abscheidung

*Marco Lisker, IHP GmbH*

### 9. Clogging-check für Injektionsventile an Centura SACVD Systemen

*Christoph van den Berg, Elmos Semiconductor AG*

### 10. Kelvinstrukturen zur Prozessanalyse

*Dirk Wolansky, IHP GmbH*